

공정 사용규제 물질

구분	Cas No.	물질명	사용제한용도 ¹⁾	관련기준	대상
금지	71-43-2	벤젠	모든 공정	산안법 ²⁾ (특별/C/M), IARC ³⁾ , 사내 기준	삼성전자 전 사업장, 협력회사
금지	110-54-3	n-헥산	모든 공정	산안법(관리/R), EU 생식독성, 사내 기준	삼성전자 전 사업장, 협력회사
제한	68-12-2	디메틸포름아미드	세척, 탈지	산안법(특별/R), IARC(2A), EU 생식독성(1B)	삼성전자 전 사업장, 협력회사
제한	75-52-5	니트로메탄	세척, 탈지	산안법(관리/C), IARC(2B)	삼성전자 전 사업장, 협력회사
제한	67-66-3	클로로폼	세척, 탈지	산안법(관리/C/R), IARC(2B), EU 생식독성	삼성전자 전 사업장, 협력회사
제한	79-01-6	TCE	세척, 탈지	산안법(특별/C/M), IARC	삼성전자 전 사업장, 협력회사
제한	108-88-3	톨루엔	세척, 탈지	산안법(관리/R), EU 생식독성	삼성전자 전 사업장, 협력회사
제한	127-18-4	PCE	세척, 탈지	산안법(특별/C), IARC(2A)	삼성전자 전 사업장, 협력회사
제한	67-56-1	메탄올	세척, 탈지, 냉각	산안법(관리/C)	삼성전자 전 사업장, 협력회사
제한	108-94-1	시클로헥사논	세척, 탈지	산안법(관리/C)	삼성전자 전 사업장, 협력회사
제한	75-09-02	디클로로메탄	세척, 탈지	산안법(특별/C), IARC(2A)	삼성전자 전 사업장, 협력회사
제한	75-21-8	산화에틸렌	세척, 탈지	산안법(특별/관리 C,M), IARC(1)	삼성전자 전 사업장
제한	109-86-4	2-메톡시에탄올	세척, 탈지	산안법(특별/관리 R)	삼성전자 전 사업장
제한	110-49-6	2-메톡시에틸아세테이트	세척, 탈지	산안법(특별/관리 R)	삼성전자 전 사업장
제한	110-80-5	2-에톡시에탄올	세척, 탈지	산안법(특별/관리 R)	삼성전자 전 사업장
제한	111-15-9	2-에톡시에틸아세테이트	세척, 탈지	산안법(특별/관리 R)	삼성전자 전 사업장
제한	50-00-0	포름알데히드	세척, 탈지	산안법(특별/관리 C,M) IARC(1)	삼성전자 전 사업장
제한	111-96-6	비스(2-메톡시에틸)에테르	세척, 탈지	EU 생식독성(1B)	삼성전자 전 사업장
제한	78-87-5	1,2-디클로로프로판	세척, 탈지	산안법(관리 C) , IARC(1)	삼성전자 전 사업장
제한	106-99-0	1,3-부타디엔	세척, 탈지	산안법(특별/관리 C ,R) , IARC(1)	삼성전자 전 사업장
제한	127-19-5	N,N-디메틸아세트아미드	세척, 탈지	산안법(특별/관리 R)	삼성전자 전 사업장
제한	106-94-5	1-브로모프로판	세척, 탈지	산안법(특별/관리 C ,R) , IARC(2B)	삼성전자 전 사업장
제한	75-26-3	2-브로모프로판	세척, 탈지	산안법(특별/관리 R)	삼성전자 전 사업장
제한	107-13-1	아크릴로니트릴	세척, 탈지	산안법(특별/관리 C) , IARC(2B)	삼성전자 전 사업장
제한	75-01-04	염화비닐	세척, 탈지	산안법(관리 C) , IARC(1)	삼성전자 전 사업장

각주: 1) 수작업 공정에 한정
 2) 국내 산업안전보건법
 3) 국제암연구소(International Agency for Research on Cancer)